## 特許協力条約

РСТ

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 YCT-1021	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2005/005693	国際出願日 (日. 月. 年) 28. 03. 2005	優先日 (日.月.年) 30.03.2004				
国際特許分類(I P C) Int.Cl. B01J29/12(2006.01), B01D53/86(2006.01), B01J29/035(2006.01), B01J29/22(2006.01)						
出願人(氏名又は名称) 日揮ユニバーサル株式会社						
<ol> <li>この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。</li> <li>この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。</li> <li>この報告には次の附属物件も添付されている。         <ul> <li>a. ※ 附属書類は全部で 2 ページである。</li> </ul> </li> </ol>						
<ul><li>一 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)</li><li>第 I 欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙</li></ul>						
b. 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)						
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	:含む。					
第IV欄 発明の単一性の	E又は産業上の利用可能性についての国際予 分欠如 に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用 及び説明 -献 i					

国際予備審査の請求書を受理した日 05.09.2005	国際予備審査報告を作成した日 28.06.2006		
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4 G	3 4 4 2
日本国特許庁(IPEA/JP)	増山 淳子		
郵便番号100-8915			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線	3 4	1 6

第	I欄	報告の基礎	
1.	言語	<b>語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。</b>	
		出願時の言語による国際出願	
		出願時の言語から次の目的のための言語である	語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))	
		国際公開 (PCT規則12.4(a))	
		国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))	
0			) の担合に甘ると人人には然よったはに担口をも
2.		D報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条 手替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添	
	/ C Z	式作ん用機は、この取品にあいて「国験時」とし、この取品でか	
		出願時の国際出願書類	
	0000		
	V	明細書	
		第 1 - 9 1 ページ 出願時に提り	日されたもの
		第 2 1 2 1	付けで国際予備案本機関が受理したもの
		第       ページ、出願時に提出         第       ページ*、         第       ページ*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V		
		第 2 , 3 , 6 - 1 3 項、出願時に提出	出されたもの
		第 <u>1</u> , 5 項*、PCT199	その規定に基づき補正されたもの サンマ国際ス件家本機関が采用したす。
		第	
			110 (国际 ) 加温显成因 文是 0 亿 0 0 0
	Y		
		第 1 - 5	出されたもの
		第1-5       ページ/図、出願時に提問         第二       ページ/図*、         第二       ページ/図*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの
		第	付けで国際予備番査機関が受埋したもの
		配列表又は関連するテーブル	
		配列表に関する補充欄を参照すること。	
3.		補正により、下記の書類が削除された。	
		, ng /m ===- /**	. 9 . 3 %
		<ul><li>明細書</li><li>第</li><li>請求の範囲</li><li>第 4</li></ul>	へーン
		請求の範囲   第     図面   第	垻 ページ/図
		配列表 (具体的に記載すること)	
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)	
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されか	
		えてされたものと認められるので、その補正がされなかった	ものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		明細書	ページ
		<ul><li>明細書</li><li>請求の範囲</li><li>第</li><li>図面</li><li>第</li></ul>	 項
			ページ/図
		配列表(具体的に記載すること)	
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)	
* 4	4. 1	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることだ	がある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N) 請求の範囲 1-3.5-13 有 無

進歩性 (IS) 請求の範囲 1-3.5-13 有 無

産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲 1-3.5-13 有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1: JP 2004-066126 A (バブコック日立株式会社) 2004.03.04 文献 2: JP 2004-076717 A (トヨタ自動車株式会社) 2004.03.11 (請求の範囲 1-3,5-12)

請求の範囲 1-3,5-12 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1,2 に対して 新規性及び進歩性を有する。

請求の範囲

文献 1,2 にはアルミナ粒子とゼオライト粒子との重量の和に対するゼオライト粒子の重量が 1wt%-70wt%であることが記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

(請求の範囲 13)

請求の範囲 13 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1,2 に対して新規性 及び進歩性を有する。

文献 1,2 にはアルミナ粒子及びゼオライト粒子を含むスラリーを支持体に塗布し乾燥することが記載されておらず、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

第Ⅷ欄 国際出願に対する意見
請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。
請求の範囲 6-12 は不明確である。請求の範囲 6-10 には「請求項 1~5」等と記載されているから、請求の範囲 6-12 は請求の範囲 4 を引用していることになるが、請求の範囲 4 は補正により削除されている。

## 請求の範囲

- [1] (補正後) 貴金属を担持したアルミナ粒子、及び、ゼオライト粒子を含み、しかも両粒子の合計重量和に対するゼオライト粒子の重量割合が1wt%~70wt%の範囲にある、有機化合物及びケイ素化合物を含有する排ガスを浄化するための触媒組成物
- [2] ケイ素化合物が有機ケイ素化合物である請求項1に記載の触媒組成物。
- [3] ケイ素化合物が有機シリコーンである請求項1に記載の触媒組成物。
- [4] (削除)
- [5] (補正後) バインダーをさらに含む請求項1~3の何れかに記載の触媒組成物。
- [6] ゼオライト粒子が貴金属を担持したゼオライト粒子である請求項1~5の何れかに記載の触媒組成物。
- [7] 貴金属がPt、Pd、Rh、Ir、Ru、これらの合金、又はこれらの混合物である請求項1 ~6の何れかに記載の触媒組成物。
- [8] ゼオライトの酸量が0.4~1.5mmolNH<sub>3</sub>/gの範囲にある請求項1~7の何れか に記載の触媒組成物。
- [9] ゼオライト中に含有されるアルカリ金属を酸化物に換算した量及びアルカリ土類金属を酸化物に換算した量の和がゼオライトの総量について5wt%以下である、請求項1~8の何れかに記載の触媒組成物。
- [10] 触媒支持体;及び、 該触媒支持体上に形成された、請求項1~9の何れかに記載の触媒組成物を含む 触媒層 を含む触媒。
- [11] 触媒層の平均厚みが10~500μmの範囲にある、請求項10に記載の触媒。
- [12] 有機化合物及びケイ素化合物を含有する排ガスを請求項10又は11に記載の触媒 と200~500℃の温度で接触し反応させる工程を含む排ガス浄化方法。
- [13] 貴金属を担持したアルミナ粒子、及び、ゼオライト粒子を含むスラリーを作成し; 該スラリーを支持体に塗布し、乾燥する; 工程を含む、

有機化合物及びケイ素化合物を含有する排ガスを浄化するための触媒の製造方法。